

# Cesta De Limpeza De Porta-Wafer Personalizada Em Ptfе: Resistente À Corrosão, Não Lixivante E Suporte Para Experimentos De Polímeros De Alto Desempenho

Número do item: PL-CP264



## introdução

Porta-wafers de PTFE personalizados e cestos de limpeza de alto desempenho projetados para pesquisa de semicondutores e polímeros. Com excelente resistência à corrosão e propriedades de lixiviação zero, essas soluções sob medida garantem processamento livre de contaminação em ambientes químicos exigentes para aplicações laboratoriais e industriais de alta precisão atualmente.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Ataque Úmido de Semicondutores	Fixação de wafers de silício durante processos de ataque à base de ácido para remover óxidos ou definir padrões.	A inércia química evita a contaminação do banho.
Análise de Metais Traço	Limpeza de vidraria e amostras em banhos de ácido de alta pureza para pesquisa ambiental ou geológica.	A lixiviação zero de metais garante precisão analítica.
Síntese de Polímeros	Suporte a portadores de catalisador ou substratos em reações à base de solvente de alta temperatura.	Alta resistência térmica e superfície antiaderente.
Fabricação de Células Solares	Transporte de substratos de silício de grande formato através de banhos de limpeza e texturização em múltiplos estágios.	Construção durável para rendimento de alto volume.
Limpeza Farmacêutica	Esterilização e limpeza de componentes delicados de vidro ou metal em soluções detergentes agressivas.	Conformidade com padrões de alta pureza e não contaminação.
Deposição Eletroquímica	Fixação de substratos durante revestimento ou deposição de metal em soluções eletrolíticas corrosivas.	Isolamento elétrico e estabilidade química.
Processamento de Optoeletrônica	Limpeza e manuseio de substratos de vidro ou safira para fabricação de LEDs e diodos laser.	Manuseio sem arranhões e enxágue sem resíduos.
Secagem de Alta Temperatura	Movimentação de wafers de banhos úmidos diretamente para câmaras de secagem aquecidas ou fornos.	Mantém a integridade estrutural até 260°C.

Característica	Detalhes da Especificação (Série PL-CP264)
Identificação do Produto	Porta-Wafer Personalizado PL-CP264
Material Principal	PTFE Virgem de Alta Pureza (PFA opcional disponível)
Status de Personalização	100% Sob Medida / Fabricado sob Encomenda
Faixa de Temperatura	-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)
Compatibilidade Química	Universal (Todos os ácidos, bases, solventes, exceto metais alcalinos fundidos)
Configuração de Ranhuras	Personalizável (Largura, Passo, Ângulo e Profundidade)

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Característica	Detalhes da Especificação (Série PL-CP264)	
Compatibilidade com Wafers	Tamanhos personalizados para 1", 2", 4", 6", 8", 12" ou formatos não padrão	
Método de Fabricação	Usinagem CNC de Alta Precisão	
Acabamento de Superfície	Liso, de baixa fricção, não poroso	
Opções de Alça	Integrada, Destacável ou Interface Robótica	
Capacidade por Lote	Projetado conforme especificação do usuário (Um ou Vários Wafers)	